Исследование возможности использования покрытий на основе нанослоев Ті и Со в поляризующей нейтронной оптике.

Матвеев В.А., ОИТОЭР ОНИ

Принцип работы поляризующего суперзеркала



2 направлением спина

переданного импульса q

Основные параметры поляризующих суперзеркал

Угловая приемная способность характеризуется параметром m, выражаемого в единицах θ_{Ni} – максимального угла, при котором происходит полное отражение нейтронов от полированной поверхности никеля:

$$m = \frac{\Theta_c}{\Theta_c^{Ni}} = \frac{q_c}{q_c^{Ni}}$$

Основной фактор, который не позволяет увеличивать угловую приемную способность суперзеркал – рост межслойной шероховатости.



Для характеристики поляризующих свойств зеркал и нейтроннооптических устройств (поляризаторов, анализаторов и т.д.) используют понятие поляризующей эффективности:

$$P = \frac{R_{+} - R_{-}}{R_{+} + R_{-}}$$

 R_+, R_- - коэффициенты отражения нейтронов со спином «вверх» и «вниз»



FeCoV/TiN supermirror (Swissneutronics)



http://www.swissneutronics.ch

Факторы уменьшающие поляризующую эффективность



Области с нулевой намагниченностью (магнитно-мертвые слои) и окисный слой формируют потенциальные барьеры от которых отражаются нейтроны обоих направлений спина. Это приводит к снижению поляризации отраженного от покрытия нейтронного пучка.



6 Pleshanov N.K. // Nucl. Instrum. Methods A. 2010. V. 613. №1. 15-22.



путем добавления в структуру суперзеркала прослоек Ті

5

•1. Pleshanov N.K. // Nucl. Instrum. Methods A. 2010. V. 613. №1. 15-22.



нейтронов Подавление отражения С направлением нежелательным спина продемонстрировано было «ВНИЗ» В работе [1]. Следующим ПО вкладу фактором является окисный слой на поверхности суперзеркала.



Экспериментальные (символы) и расчетные (линии) зависимости *R*(*q*): 1 – расчет отражения от суперзеркала с учетом всех ухудшающих факторов; 2 – расчет отражения от суперзеркала с прослойками Ті и верхним оксидным слоем; 3 – расчет отражения от суперзеркала с прослойками Ті и поглощающим подслоем; 4 - суперзеркало с прослойками Ті и с рассогласованными потенциалами соседних слоев.

1. Pleshanov N.K. // Nucl. Instrum. Methods A. 2010. V. 613. №1. 15-22.

Подавление отражения от оксидного слоя



Цель и задачи работы

Целью работы: Исследование возможности использования нанослоев Ті и Со для создания антиотражающих покрытий в составе.

Задачи:

1. Исследование бислойных систем Ti/TiO₂ и Co/CoO, формирующихся в процессе естественного окисления нанослоев Ti и Co.

2. Оценка толщины нанослоев Ті и Со, необходимых для создания антиотражающего покрытия.

3. Экспериментальная проверка подавления отражения нейтронов от поляризующих зеркал с антиотражающими покрытиями.

I. Исследование бислойных систем Ti/TiO₂ и Co/CoO

Образцы для исследований:

Бислойные системы Ti/TiO₂ и Co/CoO получались путем нанесения тонких слоев Ti и Co толщиной 5-100 нм с их последующим окислением в атмосфере воздуха при нормальных условиях в течении 80 суток. Нанесение нанослоев Ti и Co осуществлялось методом магнетронного напыления на установке ЛУНА (ФГБУ "ПИЯФ", Гатчина). Рабочее давление аргона при напылении составляло 2.5·10⁻³ мбар, а давление остаточных газов до напыления 5·10⁻⁵ мбар.

Материал мишени: технически чистый титан (ТГ-90) и технически чистый кобальт; подложка — флоат- стекло толщиной 5 мм (шероховатость подложек 0.5-1.0 нм).

Нейтронная рефлектометрия Рефлектометр NR-4M (ПИЯФ, Гатчина)



Схема рефлектометра НР-4М: (1) внутриканальный коллиматор, (2) монитор, (3) суперзеркальный отклонитель пучка, (4) коллиматор, (5) прерыватель пучка, (6) формирователь пучка в постоянном магните, (7) флиппер Корнеева, (8) Сd диафрагмы, (9) узел образца с постоянным магнитом, (10) образец, (11) радиочастотный адиабатический спин-флиппер, (12) суперзеркальный 14 СоFeV/TiZr анализатор в постоянном магните, (13) диафрагма детектора, (14) Не детектор.

Основные параметры рефлектометра HP-4M: максимальный диапазон длин волн λ: 0.5 разрешение по длине волны Δλ/λ: 0.0 плотность потока нейтронов на образце: 7.5 интегр. поляризация нейтронного пучка: 99%

```
0.5÷5 Å
0.05
7.5·10<sup>4</sup> имп∙сек<sup>-1</sup>·см<sup>-2</sup>
99%
```

Рентгеновская рефлектометрия



длина волны λ: разрешение по длине волны Δλ/λ: интенсивность на образце: 13 угловая расходимость пучка Δθ: 1.54 Å (CuKα) 0.01 10⁸ имп∙сек⁻¹∙см⁻² 0.5 угл. мин.



I. Окисление тонких пленок Ті и Со на воздухе



•
$$d_0[Ti, Co] = d[Ti, Co] + d[TiO_2, CoO]/\alpha[TiO_2, CoO]$$

II. Оценка оптимальных толщин нанослоев Ті и Со



III. Проверка эффективности покрытий



III. Проверка эффективности покрытий



<i>d</i> [оксида], нм	3.1±0.5
σ [оксида], нм	2.5±0.8
V [оксида], нэВ	126±3
<i>d</i> [FeCo], нм	103.3±0.6
σ [FeCo], нм	2.0±0.5
V+ [FeCo], нэВ	232±3
<i>V</i> - [FeCo], нэВ	-3±3
d [TiZrGd], нм	250
σ [TiZrGd], нм	1.5±0.4
V [оксида], нэВ	-47±8



Покрытия на основе бислоев Ті/ТіО2





Покрытия на основе бислоев Со/СоО



0.1

0.2

q, nm⁻¹

10⁻³

0.05



Заключение

- Установлено, что при комнатных температурах на поверхности тонких пленок Ті формируется слой оксида, толщина которого зависит от их исходной толщины титана. Для пленок Со такой явной зависимости не наблюдается и толщина оксида составляет величину порядка 2.7 нм.
- Используя полученные данные об окислении были получены оценки толщин нанослоев Ті и Со, которые необходимо напылять для создания антиотражающих покрытий.
- Экспериментальная проверка на поляризующем зеркале показала наличие эффекта подавления отражения нейтронов антиотражающем покрытием на основе бислоев Ti/TiO₂ и Co/CoO в области малых q_⊥.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Соглашение №14.607.21.0194 от 26 Сентября 2017г., RFMEFI60717X0194 Благодарю за внимание!